「半導体デバイス今昔、そして未来へ」

Semiconductor devices, old days, now, and future



徳光 永輔

先端科学技術研究科 マテリアルサイエンス系

2019 1/21日(月) 12:40 - 13:20

会場:ラーニング・コモンズ 「J-BEANS」

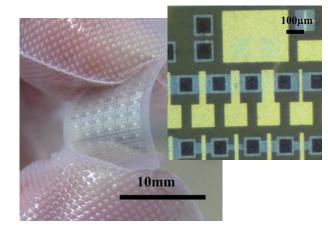
半導体デバイス、半導体集積回路の進歩は目覚ましいものがあります。現在広く使われているスマートフォンなどは、少し前までは夢のような話でした。このような進歩をもたらした半導体デバイスとはどんなものなのでしょうか。セミナーでは、集積回路の基本素子であるMOSFETの仕組みと、これらがどのように集積化されているのかを解説します。さらに現在の研究開発と将来展望、筆者ら

roclectric-Gate Thin Fin. Fransis
O Channel
yasako and Eisuke Tokumitsu
dory, Tokyo Institute of Technology,
Yokohama 226-8503, Japan

4-5961, e-mail:senoo@neuro.pi.tiech.ac channel uch as ZnO have been also Howe r, they usually need high old due to the thick gate insulator

の研究について紹介します。

Transparent nonvolatile memory transistors



Flexible memory transistors

The slides are written in English. Foreign audience is welcome!

ラーニング・コモンズJ-BEANSは、大学会館1階です。 J-BEANS is located on the 1F, Institute Hall.

J-BEANSセミナーは、JAISTで行われている研究の知識共有を目指しています。専門家以外も楽しめるセミナーを行いますので、ぜひ講師以外の学系の方もご来聴下さい。

担当教員: 先端科学技術研究科 マテリアルサイエンス系 教授 小矢野幹夫